

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平5-279447

(43) 公開日 平成5年(1993)10月26日

(51) Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
C 0 8 G 18/61	N E M	8620-4 J		
B 0 1 D 71/54		8822-4 D		
C 0 8 G 18/44	N D W	8620-4 J		

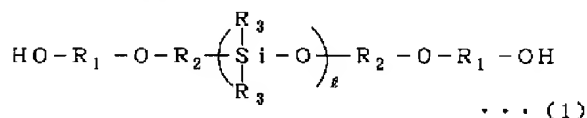
審査請求 未請求 請求項の数 3 (全 4 頁)

(21) 出願番号	特願平4-77338	(71) 出願人	000006035 三菱レイヨン株式会社 東京都中央区京橋2丁目3番19号
(22) 出願日	平成4年(1992)3月31日	(72) 発明者	河合 美穂 広島県大竹市御幸町20番1号 三菱レイヨン株式会社中央研究所内
		(72) 発明者	加茂 純 広島県大竹市御幸町20番1号 三菱レイヨン株式会社中央研究所内

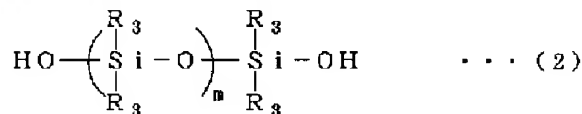
(54) 【発明の名称】 シリコン系ブロック共重合体及びそれからなる膜

(57) 【要約】 (修正有)

【構成】 一般式(1)で示されるシロキサンジオール



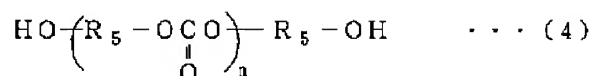
(式中 R_1 , R_2 は二価の炭化水素基、 R_3 はメチル基もしくはフェニル基、 n は8以上の整数を表す) 又は一般式(2)で示されるシロキサンジオール



(式中 R_3 はメチル基もしくはフェニル基、 m は8以上の整数を表す) 及び一般式(3)で示されるジイソシアネート



(式中 R_4 は脂肪族基、脂環族基もしくは芳香族基を表す) 及び一般式(4)で示されるカーボネートジオール



(式中 R_5 は脂肪族基、 n は3以上の整数を表す) を反応させて得られるウレタン結合を有するシリコン系ブロック共重合体。及び選択透過膜。

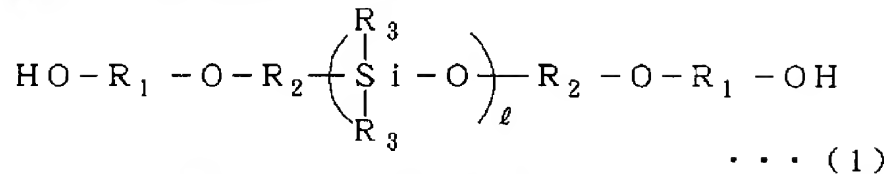
【効果】 気体透過係数の大きな分離膜が得られる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式(1)で示されるシロキサンジオリール

*ー

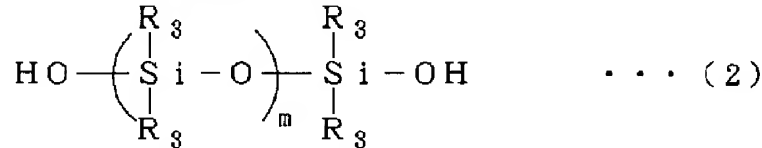
【化1】



(式中R₁, R₂は二価の炭化水素基、R₃はメチル基もしくはフェニル基、ℓは8以上の整数を表す) 又は一※

※一般式(2)で示されるシロキサンジオリール

【化2】

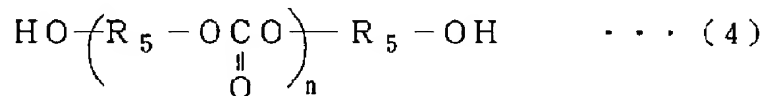


(式中R₃はメチル基もしくはフェニル基、mは8以上の整数を表す) 及び一般式(3)で示されるジイソシアネート



★(式中R₄は脂肪族基、脂環族基もしくは芳香族基を表す) 及び一般式(4)で示されるカーボネートジオリール

【化3】



(式中R₅は脂肪族基、nは3以上の整数を表す)を反応させて得られるウレタン結合を有するシリコン系ブロック共重合体。

【請求項2】 請求項1記載のシリコン系ブロック共重合体からなる選択透過膜。

【請求項3】 請求項1記載のシリコン系ブロック共重合体を、厚さ方向に連続した微細孔を有する多孔膜の表面に設けた複合膜。

【発明の詳細な説明】

30

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、新規なシリコン系プロ

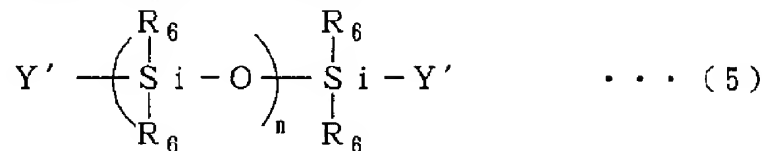
☆ック共重合体及びそれからなる、気体透過係数の大きな分離膜に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 ジメチルシロキサン/ビスフェノールAポリカーボネートから成る気体分離膜がJ. Memb. Sci., 1(1976)99-108に記載されている。

【0003】 また、一般式(5)で示されるオルガノポリシロキサン

【化4】



(式中R₆は一価アリール基、飽和脂肪族基、不飽和脂肪族基等、Y'は-R₇



, -R₇COH等、R₇は二価アリール基、アルキレン基等である)

と一般式(6)で示されるジヒドロキシ化合物



(式中Zは二価炭化水素基、オキシアリーレンオキシ基等)と、イソシアネートからなるシリコンポリカーボネートが特公昭45-20510号公報に記載されている。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、前記の文献で提案されている膜や共重合体は、気体透過速度が

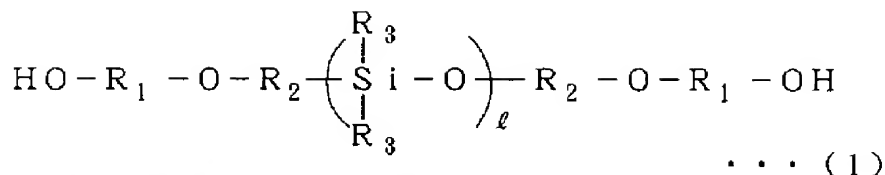
低く、また熔融成形温度が高いという問題点を有する。

【0005】 本発明は合成の容易なブロック共重合体及び気体透過係数が大きい選択透過膜、複合膜を提供することにある。

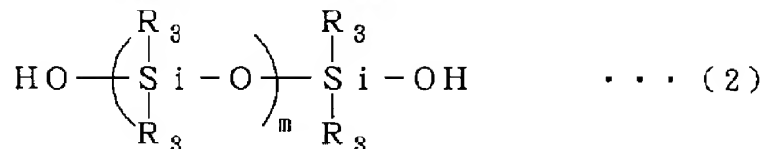
【0006】

【課題を解決するための手段】 本発明の要旨は、一般式(1)又は(2)で示されるシロキサンジオリール

【化5】



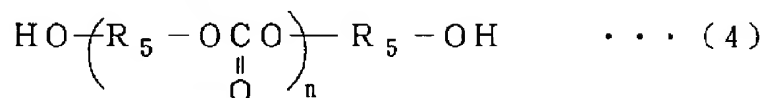
(式中 R_1 , R_2 は二価の炭化水素基、 R_3 はメチル基 * 【化6】
もしくはフェニル基、 ℓ は8以上の整数を表す) *



(式中 R_3 はメチル基もしくはフェニル基、 m は8以上の整数を表す) 及び一般式 (3) で示されるジイソシアネート



※ (式中 R_4 は脂肪族基、脂環族基もしくは芳香族基を表す) 及び一般式 (4) で示されるカーボネートジオール 【化7】



(式中 R_5 は脂肪族基、 n は3以上の整数を表す) を反応させて得られるウレタン結合を有するシリコン系ブロック共重合体にある。

【0007】さらにはシリコン系ブロック共重合体からなる選択透過膜もしくはシリコン系ブロック共重合体を、厚さ方向に連続した微細孔を有する多孔膜の表面に設けた複合膜にある。

【0008】一般式 (1) で示されるシロキサンジオールの R_1 , R_2 は好しくは炭素数1~5の炭化水素基である。

【0009】一般式 (1) 又は (2) で示される化合物で1もしくは m は好しくは10~2000、より好しくは10~60の整数である。8未満の場合は透過速度係数が低くなって好しくない。

【0010】一般式 (3) で示されるジイソシアネート化合物としては、例えばテトラメチレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、 m -キシレンジイソシアネート、 p -フェニレンジイソシアネート、4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネート等が挙げられる。

【0011】一般式 (4) で示される分子末端にヒドロキシル基を有するカーボネートジオールの n は好しくは5~25の整数である。 n が3未満の場合は、製膜性がわるくなり好しくない。

【0012】本発明において、分子末端にカルピノール基もしくはヒドロキシル基を有するシロキサンジオールと、分子末端にヒドロキシル基を有するカーボネートジオールとの反応生成物におけるシロキサンの割合は、20~80wt%の範囲にあることが好しく、より好しくは40~60wt%の範囲である。80wt%を越えて、シロキサンジオールを混合した場合は、製膜性がわ

るくなるので好しくない。又20wt%末端の場合は、気体透過係数が低くなるので好しくない。

【0013】本発明におけるウレタン結合を有するシリコン系ブロック共重合体は、下記の方法により製造することができる。まず有機溶媒中にジイソシアネート化合物を溶解し、窒素気流中で分子末端にカルピノール基又はヒドロキシル基を有するシロキサンジオールを2時間反応させ、分子両末端にイソシアネートを有する中間生成物を得る。

【0014】反応温度は60℃から90℃より好しくは70℃から80℃の範囲が良い。触媒としてはジラウリン酸ジブチル錫又は錫ジオクトエート等およびトリエチルアミン等の公知の触媒が用いられる。

【0015】次いで分子末端にヒドロキシル基を有するカルボジオールを加えて反応させ、ウレタン結合を有するシリコン系ブロック共重合体を得ることができる。

【0016】本発明におけるウレタン結合を有するシリコン系ブロック共重合体の製造に用いられる有機溶媒の例としては、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン、ジオキサン、テトラヒドロフラン等あるいはこれらと N -メチル-2-ピロリドン、 N , N -ジメチルホルムアミド、 N , N -ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、ジエチルホルムアミドとの混合溶剤が用いられる。

【0017】このようにして得られたウレタン結合を有するシリコン系ブロック共重合体は、公知の方法により平膜、管状膜、中空糸膜に製膜される。例えば、本発明の共重合体を適当な溶剤に溶解した高分子溶液あるいは重合溶液をそのままガラス板上に流延し、溶媒を蒸発させることにより、非多孔質の選択透過平膜を得ることが可能である。

【0018】又中空糸等の多孔質膜に該共重合体の高分子溶液あるいは重合溶液をコーティングすることにより、多孔質膜表面に分離機能を有する複合膜を得ることができる。

【0019】

【実施例】以下、実施例により本発明を具体的に説明する。

「部」は重量部をあらわす。

実施例1

4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネート10.1部を70℃のテトラヒドロフランとN, N'-ジメチルアセトアミドの混合溶媒100部に溶解し、窒素気流中にて数平均分子量1000の(3-オキサヘキサノール)ジメチルシロキサン20部とジラウリン酸ジブチル錫、トリエチルアミン0.15wt%をテトラヒドロフランとN, N'-ジメチルアセトアミドの混合溶媒120部に溶解したものを添加して、2時間攪拌した。

【0020】次いで平均分子量1000の1, 6-ヘキサノールカルボネートジオール20部をテトラヒドロフランとN, N'-ジメチルアセトアミドの混合溶媒150部に溶解したものを添加して18時間反応させた。得られた溶液を水、メタノールで洗浄し、ウレタン結合を有するシリコン系ブロック共重合体を80.4wt%の収率で得た。

【0021】実施例2

4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネート10.1部を70℃のテトラヒドロフランとN, N'-ジメチルアセトアミドの混合溶媒150部に溶解し、窒素気流中にて、数平均分子量1800の(3-オキサヘキサノール)ジメチルシロキサン36部とジラウリン酸ジブチル錫、トリエチルアミン0.15wt%をテトラヒドロフランとN, N'-ジメチルアセトアミドの混合溶媒120部

*0部に溶解したものを添加して、3時間攪拌した。

【0022】次いで平均分子量2000の1, 6-ヘキサノールカルボネートジオール40部をテトラヒドロフランとN, N'-ジメチルアセトアミドの混合溶媒200部に溶解したものを添加して20時間反応させた。得られた溶液を水、メタノールで洗浄し、ウレタン結合を有するシリコン系ブロック共重合体を75.9wt%の収率で得た。

【0023】実施例3

4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネート10.1部を70℃のテトラヒドロフランとN, N'-ジメチルアセトアミドの混合溶媒200部に溶解し、窒素気流中にて、数平均分子量3200の(3-オキサヘキサノール)ジメチルシロキサン64部とジラウリン酸ジブチル錫、トリエチルアミン0.15wt%をテトラヒドロフランとN, N'-ジメチルアセトアミドの混合溶媒120部に溶解したものを添加して、4時間攪拌した。

【0024】次いで平均分子量2000の1, 6-ヘキサノールカルボネートジオール40部をテトラヒドロフランとN, N'-ジメチルアセトアミドの混合溶媒200部に溶解したものを添加して24時間反応させた。得られた溶液を水、メタノールで洗浄し、ウレタン結合を有するシリコン系ブロック共重合体を71.5wt%の収率で得た。

【0025】実施例4

実施例1～3で調製した共重合体をアセトンに溶解し、ガラス板上に流延しアセトンを蒸発させることにより120μmの厚みの均質なフィルムを作製した。このフィルムを用いて、酸素ガス及び窒素ガスの透過係数を測定したところ、表1のような結果であり、極めてガス透過性に優れるものであった。

【表1】

No.	共重合体	ジメチルシロキサン含有率(%)	酸素ガス透過係数 (cc.cm/cm ² ・sec・cmHg)	分離係数 (O ₂ /N ₂)
a	実施例1調製品	32.0	3.0×10^{-9}	2.2
b	実施例2 "	37.6	6.1×10^{-9}	2.2
c	実施例3 "	53.1	1.5×10^{-8}	2.0

【0026】実施例5

ポリプロピレン多孔質中空糸膜(内径200μm, 膜厚25μm, 平均孔径0.1μm)の膜上に実施例1で調製した共重合体をコーティングした。

【0027】酸素ガスの気体透過量を測定したところ、 6.9×10^{-5} cc/cm²・sec・cmHgで、酸素ガスと窒素ガスの分離係数は2.2であり、膜に欠陥

はなかった。気体透過量から計算される膜のコーティング厚みは、0.43μmであった。

【0028】

【発明の効果】本発明のウレタン結合を有するシリコン系ブロック共重合体は、気体の透過性能に優れかつ良好な製膜性と膜強度を保持するものであり、気体分離用途や浸透気化分離等に極めて有用な材料である。